1D14

金属ナノギャップにおける

表面増強ラマン散乱光子の偏光異方性観測

(北大院理) 〇長澤 文嘉、高瀬 舞、並河 英紀†、村越 敬

【序論】

多くの重要な反応環境を提供する固液界面において、分子の情報を得ることは反応性の本 質理解や制御に必要不可欠である。中でも、分子の振動情報を高感度にて取得することによ り、その反応系における分子固有の状態や挙動をより詳細に検討することが可能となる。一 方、表面増強ラマン散乱(SERS)は、金属表面上に生じる局在表面プラズモン共鳴(LSPR)に起 因する強い電場によって、通常微弱なラマンシグナルを *in-situ* にて単分子レベルにて測定す ることを可能とすることが知られている。本研究では、LSPR によって金属表面上にて生じ る異方的な電場が SERS 過程に寄与することに着目し、SERS 散乱光の偏光異方性の検討か ら分子配向の情報抽出を試みた。SERS 高活性な単一のサイトにて、吸着量が制御された少 数分子由来の偏光 SERS スペクトルを取得することにより分子の吸着的挙動の評価が可能と なった。

【実験】

SERS 高活性基板として Angle Resolved Nano-sphere Lithography 法を用いて異方性の制御さ れた Ag ダイマー構造体を規則的にガラス基板上に構築した。この作成した基板を濃度の既定 されている 4,4'-bipyridine (44bpy)水溶液に浸漬し、励起光強度 50 µW,露光時間 1 s にて近赤 外顕微偏光ラマンスペクトル測定を行った。44bpy 水溶液濃度 1 µM にて SERS スペクトル測 定を行い、このラマン観測サイトを保持した状態にて水溶液濃度を 1 mM まで変化させた。 ラマン測定において、入射光の偏光方位に対して平行と垂直の偏光方位を有する散乱光を同 時に計測した。得られた SERS スペクトルにおける各振動バンドは、Gaussian 03 を用いた DFT 計算(B3-LYP/6-31G)、ならびに検出分子の単結晶を用いた偏光ラマン基準測定の結果と 対照することによって帰属した。

【結果と考察】

Fig. 1に Ag ダイマー構造体の AFM 像とこの Ag ダイマーに対する入射偏光 方位を 90°変えて測定した吸収スペク トルを示す。Ag ダイマーの長軸方位に 沿った偏光を有する入射光を用いると、 短軸の偏光を有する場合とは異なり LSPR の励起に起因する吸収の極大値 が 785 nm 近傍にて観測された。この長 軸方位に生じる LSPR によってラマン



Fig. 1. Ag ダイマー構造体の AFM 像(a), と基板 の吸収スペクトル(b):入射光が Ag ダイマーの 長軸方位に対して平行(実線), 短軸方位に対し て平行 (点線)。

シグナルが増大すると考えられる。観測される SERS シグナルの増強には、入射光による LSPR の励起とそれによるラマン励起過程の増大と、ラマン散乱光によって LSPR が励起さ れシグナルが増大する2段階の機構が提案され ている。ここから、入射、散乱の両過程におい て LSPR が励起されると、強い SERS シグナ ルが生じると考えられる。Fig.2(a,上段)に、 LSPR を誘起する Ag ダイマーの長軸方位と入 射、散乱光共に平行の場合の SERS スペクトル を示す。これより、予想通り強い SERS シグナ ルが得られることが分かった。また、散乱光が 短軸方位となる場合にはシグナルがほとんど 観測されないことが分かる(Fig. 2a, 下段)。本 基板を用いて、SERS スペクトル測定を行った 際に、観測しているスペクトルに起因する構造 体は単一であることが報告されている[1]。これ より、単一 Ag ダイマー間隙に分子が存在し、 異方的な LSPR によって SERS が生じている



Fig. 2. 上から偏光 SERS スペクトル(入射散 乱偏光が平行)、44bpy 単結晶の偏光ラマン スペクトル、分子軌道計算によるラマンスペ クトル、偏光 SERS スペクトル (入射散乱偏 光が垂直)、(a),(b)は異なる観測サイト。

ことが確認された。本測定において、同じ水溶液濃度においても観測サイトによっては Fig. 2(b)に示すように偏光応答性が異なり、散乱光が短軸方位の偏光の場合にもシグナルが観測 される場合が存在した。これらの差異について検討するために、分子軌道計算によるラマン 散乱強度の偏光異方性並びに、単結晶偏光ラマン計測結果と比較した(Fig. 2 中段)。これよ り、金属表面上に生じる吸着配向の差によって SERS スペクトルの偏光異方性が変化してい ることが示唆された。

これら観測サイトを保持した状態で、金属表面上 における分子の吸着量を水溶液濃度によって制御し、 SERS 測定を行った。Fig.3は、入射、散乱光の偏光 方位が平行と垂直の場合の SERS 強度比を相対強度 として求め、各溶液濃度に対してプロットしたもの を示す。各溶液濃度のスペクトルから吸着配向が分 かり、それぞれの吸着配向に依存して相対強度が変 化することが明らかとなった。これより、44bpy 水溶 液濃度に依存したシグナル強度比の変化は、金属表 面上の分子の吸着配向に依存しているものと考えら





れる。さらに溶液濃度を変えることによって、単一ナノギャップ間隙内の分子の揺動の変化 が生じ、SERS 散乱光子の異方性に影響を及ぼすことが示唆された[2]。

【参考文献】

[1] Y. Sawai et al., J. Am. Chem. Soc., 129, 1658 (2007)

[2] F. Nagasawa et al., Chem. Comm., 47, 4514 (2011)